



中华人民共和国国家标准

GB/T 41652—2022

刻蚀机用硅电极及硅环

Silicon electrode and silicon ring for plasma etching machine

2022-07-11 发布

2023-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)共同提出并归口。

本文件起草单位：有研半导体硅材料股份公司、山东有研半导体材料有限公司、新美光(苏州)半导体科技有限公司、浙江海纳半导体有限公司。

本文件主要起草人：库黎明、孙燕、闫志瑞、张果虎、夏秋良、潘金平。